

величины  $W$  ( $W=W_2$ ) и  $T_s' (T_s'=T_2')$ . Если  $W_2 < W_r$ , то происходит наполнение диверторного слоя и устанавливается новое равновесие, при этом поток нейтралов  $T_N$  монотонно увеличивается. Однако, если  $W=W_3 > W_r$ , то по мере увеличения  $N$  происходит „запирание” нейтралов в диверторе, и поток  $T_N$  значительно уменьшается. Это может приводить к улучшению удержания плазмы и уменьшению  $T_s (T_s=T_3 < T_2)$ , в результате чего баланс частиц (1) может установиться на более низком уровне потоков  $T_N=T_s=T_3 < T_2$ .

## Л и т е р а т у р а

- [1] Wagner F., Keilhacker M. et al. - J. Nucl. Mater., 1984, v. 121, p. 103-113.
- [2] Wagaumi M. et al. ibid., p. 114.
- [3] Kuye S.M. et al. ibid., p. 115-125.
- [4] Furth H.P. Proc 12 th Eur. Conf. on Contr. Eus. and Plasma Phys. Budapest, 1985 - inoited paper.
- [5] Krasheennikov S.I., Kukushkin A.S., Pozharov V.A. Proc. 11<sup>th</sup> Intern. Conf. on Plasma Phys. and Contr. Nucl. Fus. Res., Kyoto, 1986. Rep. IAEA-CN-47/E-III-3.
- [6] Игитханов Ю.Л. и др. - Физика плазмы, 1986, т. 12, с. 3-13.
- [7] Post D.E. et al. - J. Nucl. Mater., 1984, v. 121, p. 171-177.
- [8] Крашениников С.И., Пожаров В.А. Гидродинамика нейтральной компоненты в диверторной плазме. Препринт ИАЭ-4173/7. М., 1985.

Поступило в Редакцию  
4 июня 1987 г.  
В окончательной редакции  
13 декабря 1987 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 6

26 марта 1988 г.

## ЭФФЕКТ СТАЦИОНАРНОГО СВЕЧЕНИЯ КАНАЛА ПРОВОДИМОСТИ УДАРНОСЖАТОГО ДИЭЛЕКТРИКА МДМ-СТРУКТУРЫ

Н.Д. Семкин, С.М. Семенчук, Г.Я. Юсупов

Исследуемые МДМ-структуры находят широкое применение в фундаментальных областях астрофизики, космохимии и ряде прикладных задач [1-3].

При проведении экспериментов с использованием электростатического ускорителя нами был обнаружен режим включений в цепь постоянного напряжения МДМ-структуры, при котором возникает стационарное свечение участка органического диэлектрика, подвергнутого ударному воздействию алюминиевых частиц  $\phi 0.1\text{--}0.5$  мкм в диапазоне скоростей  $4\text{--}12$  км·с $^{-1}$  и хромовых частиц  $\phi 1\text{--}20$  мкм,  $V \leq 2$  км·с $^{-1}$ . Сопротивление канала проводимости (участка сжатого органического диэлектрика) находится в пределах  $10^5\text{--}10^6$  Ом, а ток проводимости составляет  $\sim 10^{-3}\text{--}10^{-4}$  А. Свечение является стабильным во времени, наблюдается визуально в течение нескольких часов и более, а его интенсивность линейно связана с величиной поданного на МДМ-структуре постоянного электрического поля. В процессе экспериментов было зафиксировано более 100 светящихся каналов проводимости. При отключении напряжения источника питания конденсатора свечение исчезает и возобновляется при его включении.

При увеличении напряжения  $U_c$  до 250–300 В (при толщине диэлектрика конденсатора 0.8–1 мкм) наступает пробой ударноожатого канала проводимости взрывного характера, при этом вторично-электронным умножителем и фотоэлектронным умножителем регистрируется резкое увеличение ионов, электронов и интенсивности света. Материал частицы, находящийся в кратере [4], испаряется, ионизируется; заряженная компонента плазменного сгустка может быть разделена во времени в соответствии с массами ионов с помощью электрического поля [1]. При сопротивлении канала проводимости менее  $10^5\text{--}10^4$  Ом происходит его пробой. При сопротивлении канала более  $5\cdot 10^6$  Ом свечение также не возникает. При ударном воздействии частицы температура в зоне контакта нагревает верхнюю обкладку и диэлектрик конденсатора. При этом увеличивается количество свободных носителей (электроны, ионы) в области ударно-ожатого канала проводимости диэлектрика, а приложенная энергия электрического поля к МДМ-структуре превращает кратковременный процесс взаимодействия в стационарный режим свечения, при котором в канале проводимости выделяется энергия порядка  $10^{-2}\text{--}1$  Вт, что является достаточным, учитывая низкую теплопроводность диэлектрика и малые геометрические размеры канала, чтобы нагреть ударноожатый участок диэлектрика до температур порядка 500–900 °С.

Блок-схема экспериментальной установки приведена на рис. 1 и содержит электростатический ускоритель 1, цилиндр Фарадея 2, усилители 3, люминесцентно-конденсаторный датчик 4–8, фотоэлектронные умножители (ФЭУ) 9, 11, вторично-электронный умножитель 10, осциллографы 12, времязадающий масс-спектрометр 13.

Люминесцентно-конденсаторный датчик состоит из конденсатора (металл – верхняя обкладка 8 толщиной 0.1 мкм, диэлектрик – полиметилметакрилат 7 толщиной 1.2–1.4 мкм, нижняя медная обкладка 6 толщиной 50 мкм), люминофора 5, стеклянной подложки 4. Люминесцентный датчик совместно с цилиндром Фарадея служит для контроля параметров частицы.

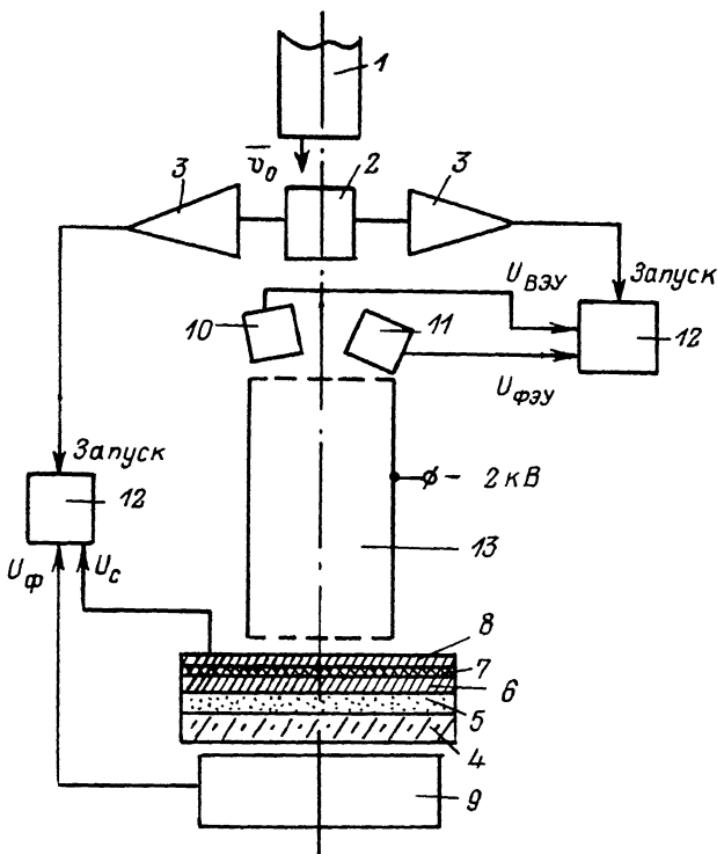


Рис. 1.

С помощью масс-спектрометра 13 получены спектры ионов с поверхности ударноскжатого канала проводимости конденсатора 6, 7, 8 в диапазоне напряжения питания  $U_c = \pm 400$  В. Результаты обработки приведены на рис. 2 в виде зависимости заряда для каждого химического элемента ( $Al, He, Na, K, O, H$ ) от напряжения на конденсаторе. При ударе частицы происходит частичный пробой ударноскжатой области диэлектрика, являющейся функцией напряжения на конденсаторе. Наблюдается интенсивный выход ионов водорода, образующихся в результате автоэлектронной эмиссии в диэлектрике. Происходит частичный разрыв химических связей в диэлектрике, в результате чего ударноскжатый канал становится металлоорганическим соединением с удельным сопротивлением  $\sim 10-100$  Ом·см, в котором атомы водорода замещены атомами металла (алюминия, калия, натрия).

Материал ударноскжатого канала проводимости содержит больше углерода по сравнению с водородом и кислородом. Изменяя материалы частицы и верхней обкладки, можно получать различные свойства металлоорганического соединения в ударноскжатой зоне.

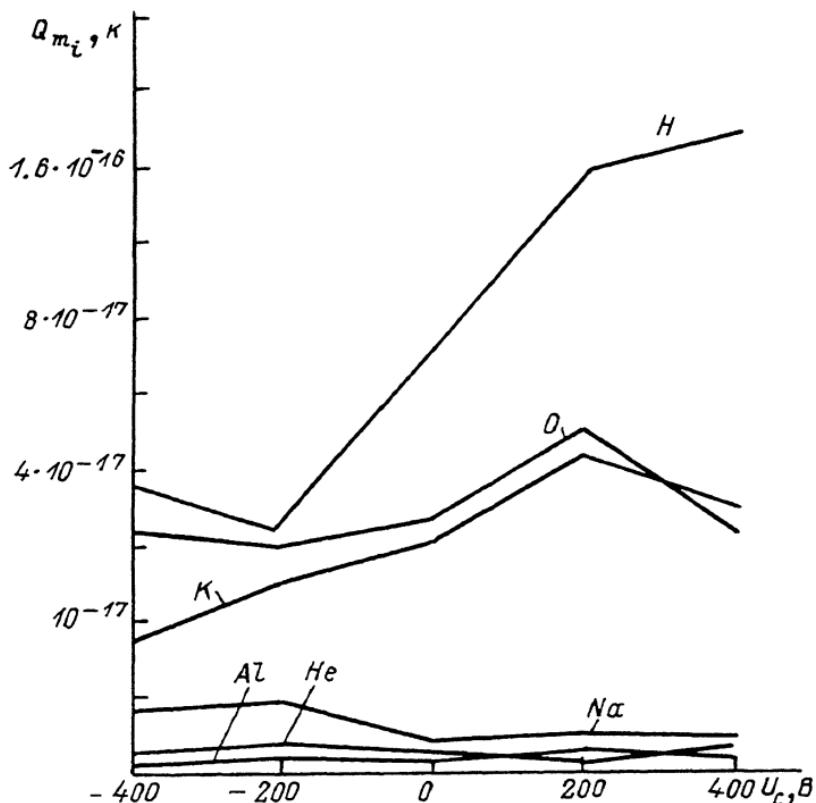


Рис. 2.

Часть выделяющейся энергии в канале проводимости идет на разогрев его и на излучение, другая часть энергии отводится на нижнюю (медную) обкладку конденсатора. В результате чего поддерживается тепловое равновесие. При напряжении  $U_c > 300$  В (толщина диэлектрика  $\sim 1$  мкм) происходит пробой. При толщине диэлектрика 2–2.5 мкм в том же диапазоне масс и скоростей частиц было обнаружено стационарное свечение канала проводимости лишь в течение 4–7 с даже при напряжении  $U_c = 400$ –450 В.

Для устойчивого свечения канала проводимости при толщине диэлектрика 2–2.5 мкм необходимо увеличивать скорость частицы. Таким образом, условием существования стационарного свечения ударноожжатого участка диэлектрика является определенная энергия электрического поля и частицы, справедливая для конкретного материала и геометрии конденсатора, а также диапазона масс и скоростей частиц. Эксперименты, проведенные с конденсаторами на основе неорганических диэлектриков ( $SiO_2$ ,  $GeO$ ), не обнаружили существования режима стационарного свечения, ударноожжатой зоны. Конденсаторы, имеющие сопротивление менее  $10^6$  Ом, непосред-

ственno после их получения также не обнаруживают свечения. Эффект стационарного свечения ударно-сжатого участка диэлектрика может использоваться в датчиках для регистрации и запоминания ударных воздействий частиц (например, микрометеоритов), в области микроэлектроники, а также при исследовании твердых тел под высоким давлением.

## Л и т е р а т у р а

- [1] A u e r S., B e r g O.E. - Rev. Sci. Instrum., 1975, v. 46, N 11, p. 1531-1534,
- [2] Х е й с Б. - Приборы для научных исследований, 1975, т. 12, с. 69-79.
- [3] С е м к и н Н.Д. Изв. вузов, Приборостроение, 1986, т. XXIX, № 8, с. 60-64.
- [4] N e n k u m G. Untersuchungen des Projectilmaterines in Microcratern. Diplomarbeit universität Heidelberg, 1969, English Translation, NASA, TT-F-12327.

Куйбышевский авиационный  
институт им. С.П. Королева

Поступило в Редакцию  
28 января 1987 г.

В окончательной редакции  
28 октября 1987 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 6

26 марта 1988 г.

## ОРИЕНТАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ МНОГОКРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ ПРИ МАЛЫХ УГЛАХ ВЛЕТА В КРИСТАЛЛ

А.Р. А в а к я н, Р.О. А в а к я н, А.В. А в е т и с я н,  
А.С. А р у т ю н я н, С.С. Д а н а г у л я н,  
С.П. Т а р о я н, Я н Ш и

При малых углах влета релятивистских заряженных частиц в кристалл относительно кристаллографической оси или плоскости частицы одновременно взаимодействуют с большим количеством атомов оси или плоскости (когерентное рассеяние). Такое взаимодействие можно описывать непрерывным потенциалом осей или плоскостей [1]. В то же время частицы многократно рассеиваются на тепловых колебаниях отдельных атомов (некогерентное рассеяние), что в конечном итоге приводит к увеличению среднего квадрата угла движения частиц относительно исходного направления и, соответственно, к монотонному уширению пучка по мере проникновения в кристалл. Ранее [2, 3] теоретически была показана возможность подавления некогерентного многократного рассеяния электронов при плоском канализировании и квазиканализировании в кристаллах по сравнению со случаем аморфного вещества.